

(19) 日本国特許庁(JP)

## (12) 特許公報(B2)

(11) 特許番号

特許第5629050号  
(P5629050)

(45) 発行日 平成26年11月19日(2014.11.19)

(24) 登録日 平成26年10月10日(2014.10.10)

(51) Int.Cl.	F 1
GO2B 13/24 (2006.01)	GO2B 13/24
GO2B 13/18 (2006.01)	GO2B 13/18
HO1L 21/027 (2006.01)	HO1L 21/30 515D

請求項の数 5 (全 10 頁)

(21) 出願番号	特願2007-526253 (P2007-526253)
(86) (22) 出願日	平成17年6月2日(2005.6.2)
(65) 公表番号	特表2008-502012 (P2008-502012A)
(43) 公表日	平成20年1月24日(2008.1.24)
(86) 国際出願番号	PCT/EP2005/005930
(87) 国際公開番号	W02005/121899
(87) 国際公開日	平成17年12月22日(2005.12.22)
審査請求日	平成20年4月15日(2008.4.15)
審判番号	不服2013-11448 (P2013-11448/J1)
審判請求日	平成25年6月18日(2013.6.18)
(31) 優先権主張番号	60/578,522
(32) 優先日	平成16年6月10日(2004.6.10)
(33) 優先権主張国	米国(US)

(73) 特許権者	503263355 カール・ツァイス・エスエムティー・ゲーエムベーハー
	ドイツ連邦共和国、73447 オーバーコッヘン、ルドルフ・エーバー・シュトラーセ 2
(74) 代理人	100092093 弁理士 辻居 幸一
(74) 代理人	100082005 弁理士 熊倉 賢男
(74) 代理人	100067013 弁理士 大塚 文昭
(74) 代理人	100086771 弁理士 西島 幸喜

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】マイクロリソグラフィ投影露光装置のための投影対物レンズ

## (57) 【特許請求の範囲】

## 【請求項 1】

各 ひとみ 平面及び各中間像平面が隣接する二つのセクションを分離する、N = 4 である投影対物レンズ(10)の連続セクション A1 ~ AN に配置された複数の光エレメント(P、S、L1 ~ L8、L13、L19)を備えた、マイクロリソグラフィ投影露光装置の投影対物レンズであって、

前記投影露光装置は、物体面及び像面を有し、前記投影露光装置が縮小する倍率で、前記物体面に配置される物体の像を前記像面に生成するように、前記投影露光装置は、構成され、

少なくとも 2 つの光エレメントが、それぞれ、局部的に非球面再処理された湾曲した表面を有し、前記局部再処理が、光軸に対して回転対称ではなく、第 1 の光エレメントが、j = 1 . . . N である 1 つのセクション Aj に配置され、第 2 の光エレメントが、k = 1 . . . N である他のセクション Ak に配置され、差の絶対値 | k - j | が奇数であり、

前記第 1 の光エレメント及び前記第 2 の光エレメントの組み合わせは、複数のセクションに渡って複数分布する摂動によって生じる、偶数対称成分及び奇数対称成分の両方を含む視野依存性を持つ波面変形を修正することを特徴とする投影対物レンズ。

## 【請求項 2】

ひとみ平面(E1、E3)またはその近傍に配置された、同じく、局部的に非球面再処理された表面を有する第 3 の光エレメントを特徴とする請求項 1 に記載の投影対物レンズ。

**【請求項 3】**

局部材料浸食によって前記再処理が実行されることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の投影対物レンズ。

**【請求項 4】**

前記局部材料浸食の量が 500 nm 未満、好ましくは 200 nm 未満であることを特徴とする請求項 3 に記載の投影対物レンズ。

**【請求項 5】**

前記波面変形が、前記複数の光エレメントのうちの 1 つの形状誤差または屈折率不均質によって生じることを特徴とする請求項 1 から 4 の一項に記載の投影対物レンズ。

**【発明の詳細な説明】**

10

**【技術分野】****【0001】**

本発明は、微細構造コンポーネントの製造に使用されるものなど、マイクロリソグラフィ投影露光装置のための投影対物レンズに関する。

**【背景技術】****【0002】**

大規模集積電気回路の製造に使用されるものなど、マイクロリソグラフィ投影露光装置は、投影光ビームの生成に使用される照明デバイスを有している。投影対物レンズの物体平面に配置される投影露光システムによって、結像される構造を含んだレチクルに向かって投影光ビームが照射される。投影対物レンズは、投影対物レンズの像平面に配置され、たとえばウェハの上に設けられた感光性表面に、レチクルの構造を縮小した画像を形成する。

20

**【0003】**

結像される構造のサイズが微小であるため、投影対物レンズの結像特性には厳しい要求が課せられている。したがって許容される結像誤差は極めて微小な範囲に限られている。

**【0004】**

通常、発生する結像誤差は、以下のカテゴリに分類される。一方では、投影対物レンズの設計、詳細には、投影対物レンズに含まれている光エレメントの寸法、材料、距離の仕様に起因する結像誤差が存在している。これらの設計誤差については、ここではその説明は省略する。

30

**【0005】**

他方では、製造誤差または材料誤差に起因する、一般的には対物レンズの完成時に一度だけ修正することが賢明である結像誤差が存在している。製造誤差の例には、光学表面の場合、表面精度からの逸脱を意味することを意図したいわゆる形状誤差が含まれている。しかしながら、材料誤差は、通常、光活性表面、つまり投影光が通過する表面の状態に影響を及ぼすことはないが、光エレメント内部の屈折率プロファイルが不均質になる原因になっている。以下の説明では、製造または材料によるこのような結像誤差の可能原因是、当該光エレメントの極めて狭い範囲に局部的に限定されることも、あるいはかなり広い領域にわたって展開することもある摂動として、より広義に参照されている。

**【0006】**

40

このような摂動によって生じる波面変形を修正するために、一般的には材料浸食を必要とする再処理によって投影対物レンズの適切な光学表面に修正構造を適用することが知られている。この再処理によって、表面に、通常は回転対称ではない、投影対物レンズの設計が基づいた形状とは異なる非球面形状がもたらされる。「Nanometer Asparren: Wie herstellen und wofuer?」(Feinwerktechnik und Mechnik 99 (1991年)、10、437~440頁)という名称の C. Hofmann らの論文に、このような再処理方法が詳細に記載されている。

**【0007】**

U.S. 2,689,03 B1 に、補償に必要な修正構造を一般的には測定技法によ

50

って記録することができる波面変形から予測することができる方法が詳細に記載されている。この特許に記述されている方法によれば、撮動を補償するためにその表面が局部的に再処理される光エレメントは、投影露光装置のレチクルと投影対物レンズの間に配置される平行平面板であることが好ましい。さらに、既知の修正エレメントを対物レンズ内のダイヤフラムの前段または後段に配置することができ、その場合、投影光ビームの断面がとりわけ小さくなる位置に配置されることが好ましい。

#### 【0008】

しかしながら、投影対物レンズ内のすべての光活性表面が必ずしも局部再処理による波面変形の修正に等しく適しているわけではないことが分かっている。投影対物レンズには、通常、極めて多数の光活性表面が含まれているため、これらのすべての表面の修正能力を計算で決定することは実際には容易に可能ではない。したがって、撮動を補償するために再処理すべき光活性表面の選択は、通常、実験値または経験に頼っている。たとえば、上記 U S 6 268 903 B1 で知られている方法の基本的な判定基準として、直徑が小さい投影光ビームがハイライトされている。

10

#### 【0009】

しかしながら、再処理すべき表面を選択するための知られている基準では、結像特性を十分に改善することができないことがしばしばあることが分かっている。

#### 【発明の開示】

##### 【発明が解決しようとする課題】

#### 【0010】

20

したがって本発明の目的は、生じる波面変形が光活性表面を再処理することによってより効果的に補償される投影対物レンズを提供することである。

#### 【課題を解決するための手段】

#### 【0011】

この目的は、マイクロリソグラフィ投影露光装置の投影対物レンズによって達成される。投影対物レンズは、ひとみ平面または中間像平面によって互いに分離された、N 2 である投影対物レンズの連続セクション  $A_1 \sim A_N$  で配置された複数の光エレメントを有している。波面変形を修正するために、少なくとも 2 つの光エレメントが、それぞれ、局部的に非球面再処理された光活性表面を有している。第 1 の光エレメントは、 $j = 1 \dots N$  である 1 つのセクション  $A_j$  に配置され、第 2 の光エレメントは、 $k = 1 \dots N$  である他のセクション  $A_k$  に配置されている。絶対値の差  $|k - j|$  は奇数である。

30

#### 【0012】

本発明は、適切な再処理によって波面変形を修正するための適切性に関して、光活性表面には基本的な差があることの発見に基づいている。この点に関して、基本的な判定基準には、再処理を施すことが検討されている表面が存在している、ひとみ平面または中間像平面によって互いに分離された投影対物レンズのセクションが含まれている。事実、1 つのセクションに存在している、方位角に対する視野依存性が奇数対称を有している波面変形は、隣接するセクションの再処理表面によってではなく、同じセクションの再処理表面によってのみ修正することができる分かっている。直ぐ隣のセクションを除く隣接セクション、より一般的には  $n \pm 2 k$  番目のセクションに存在している再処理表面によってのみ、ほぼ完全な修正を達成することができる。

40

#### 【0013】

その理由は、撮動によって生じる波面変形の視野依存性の奇数成分に影響を及ぼすが、偶数成分に影響を及ぼさない、画像反転がひとみ平面と中間像平面に生じることによるものである。

#### 【0014】

投影対物レンズ内の既知の位置に单一の撮動しか存在していない場合、その撮動によって生じる波面変形は、その撮動と同じセクションに存在している光活性表面を再処理することによって修正することができる。しかしながら、通常、投影対物レンズの複数のセクション全体に分布している未知の位置に複数の撮動が存在している。それらの撮動による

50

影響が重畠し、それらが相俟って波面が変形することになる。

【0015】

そのために、直ぐ隣の少なくとも2つのセクションの表面を再処理するか、あるいは偶数の他のセクションが間に存在している2つのセクションの表面を再処理しなければならない。これは、同じセクションnと直ぐ隣のセクションを除く隣接セクションn±2、またはより一般的には、k=0、1、2、...であるセクションn±2k内で撮動毎に修正が実行されることを意味しており、変形によって生じる、偶数対称成分と奇数対称成分の両方を含むあらゆる視野依存波面変形をほぼ完全に修正することができる保証されるのは、この方法によってのみである。

【0016】

10

また、一般的には望ましいことであるが、視野非依存波面誤差、つまりすべての視野ポイントに共通の誤差を修正しなければならない場合、ひとみ平面内またはひとみ平面の近傍に配置される第3の光エレメントも、局部的に再処理された光活性表面を有していかなければならない。したがって、この方法で選択される投影対物レンズ内の位置に合計3つの再処理表面を有することにより、すべての波面変形を十分良好に修正することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0017】

以下、本発明の例示的実施形態について、図面を参照して説明する。

【0018】

20

図1は、マイクロリソグラフィ投影露光装置の、一括して10で示されている投影対物レンズを通る経線を逐次描写で示したものである。以下で説明するように、ここでは逐次描写がより有利であり、この投影対物レンズの真の描写については、ビームを偏向させるために使用される2つの平面鏡が同じく描写されている、その開示のすべてが本出願に組み込まれている本出願人のWO 2004/010164 A2を参照されたい。

【0019】

投影対物レンズ10は、投影露光装置が動作している間、投影対物レンズ10の物体平面12に導入されるレチクル(図1には示されていない)の構造を感光性表面(同じく図1には示されていない)に結像するように設計されている。この表面は、たとえばウェハの上に適用することができ、投影対物レンズ10の像平面14に配置される。

【0020】

30

投影対物レンズ10は、入口側に配置された平行平面板Pと多数のレンズを有している。図1には、分かり易くするために、例示的実施形態を説明するためにより重要である、参照符号L1~L8、L13、L19で示すいくつかのレンズのみが示されている。投影対物レンズ10は、さらに、Sで示されている球面結像ミラーを備えており、このミラーを通して、図1の逐次描写の中を通過する光を見ることができる。

【0021】

以下、投影対物レンズ10を通過する投影光の経路について、物体平面12に配置された2つの視野ポイントFP1とFP2を起点とする光線経路15を参照して説明する。投影光15は、平行平面板Pを通過した後、平面偏向ミラー(この逐次描写には示されていない)に到達し、レンズL1~L4を逐次通過する。投影光は、ひとみ平面E1に配置されている球面結像ミラーSで反射した後、今度は逆の順序でレンズL1~L4を通過して戻る。

40

【0022】

物体平面12の照射された視野は、投影対物レンズ10の光軸16に対してオフセットして配置されているため、光ビームは、結像ミラーSで反射した後、入射する光ビームに対して空間オフセットをもたらす経路に沿って移動する。レンズL1の背面では、結像ミラーSに入射する光ビームと、結像ミラーSで反射する光ビームの間のこのオフセットが非常に大きいため、反射した光ビームは第1の偏向ミラーには当たらず、その代わりに、レンズL6を通過した後、第2の平面偏向ミラー(同じくこの逐次描写には示されていない)に到達する。

50

## 【0023】

投影光は、第2の偏向ミラーで反射した後、多数の他のレンズL7～L19および平行平面クロージャ板を通過し、最後に投影対物レンズ10の像平面14に到達する。

## 【0024】

レンズ5とレンズ6の間に中間像平面E2が存在しており、また、レンズ13には別のひとみ平面E3が存在している。2つのひとみ平面E1、E3と中間像平面E2は、投影対物レンズ10全体を合計4つのセクションA1、A2、A3、A4に再分割しており、レンズL2、L3、L4は、投影光が透過する方向に応じてセクションA1とセクションA2の両方に結合されている。

## 【0025】

ひとみ平面E1、E3と中間像平面E2は、それぞれ、画像を反転させる特性、つまりシステムの結像を反転させる特性を有している。これについては、ひとみ平面E1に関して、視野ポイントFP1を起点とする主光線18の例を参照して説明する。主光線18は、セクションA1では、つまり結像ミラーSで反射する前は、光軸16より下側でレンズL2を通過し、一方、結像ミラーSで反射した後は、光軸16より上側で同じレンズL2を通過する。つまり光軸16より下側でレンズL2を通過した主光線18は、結像ミラーSで点反射する。

10

## 【0026】

ひとみ平面E1を介した結像の反転は、中間像平面E2に生成される、物体平面12の対象（視野ポイントFP1、FP2）に対して反転されている中間画像20の位置でも見  
20  
ることができる。

## 【0027】

もう1つのひとみ平面E3と中間像平面E2にも同様の考察が適用される。

## 【0028】

ここで、レンズL2はその表面F5（これらは、投影対物レンズ10を通して連続番号が振られている）に、22で示す、上で説明したように光軸16に対して回転対称である必要はない摂動を有していると仮定する。この摂動の原因は、たとえば形状誤差によるものであり、あるいはレンズ材料の屈折率の不均質性によるものである。

## 【0029】

摂動22による影響は、摂動22を通過するすべての光波が望ましくない方法で変形することである。このコンテキストにおいては、光波は、物体平面12のすべての視野ポイントを起点としていることに留意されたい。これらの光波のうちの1つの波面が変形することになるかどうか、また、変形する場合、その変形に至る過程は、通常、関連する光波の起点となる視野ポイントによって決まる。とりわけひとみ平面外の摂動の場合、一般的には偶数個の視野ポイントが存在しており、これらの視野ポイントを起点とする光波は、摂動を通過しないため、摂動の影響を全く受けない。

30

## 【0030】

理想的な波面には球面波が存在しているため、出口ひとみの波面変形を説明することが最も分かりやすい。波面変形を記述する場合、いわゆるZernike多項式 $Z_r$ がしばしば使用される。このZernike多項式 $Z_r$ は、単位円内で直交する極座標で一般に表される関数系である。この場合、無限次元ベクトル空間のベクトルとして波面変形を表すことができ、ベクトルの基底がZernike多項式 $Z_r$ によって張られる。このコンテキストにおいては、波面変形は、Zernike多項式 $Z_r$ に展開された波面変形として参照されることもある。この展開式の係数は、前述のベクトルの成分である。

40

## 【0031】

この場合の最初の仮定として摂動22の位置が分かれている場合、個々の視野ポイントを起点とする光波に対して、個々の光波の波面が摂動22によって変形するかどうかを決定することができ、また、変形する場合、その変形の過程を決定することができる。たとえばZernike多項式 $Z_r$ を使用して、視野ポイントと結合した波面変形を記述することができる。逆に、記述した波面変形から、単一のZernike多項式 $Z_r$ によって

50

定義される特定の波面変形が個々の視野ポイント全体に分布する過程を決定することも可能である。たとえば Zernike 多項式  $Z_2$  によって記述される波面の傾斜は、たとえば視野ポイントが光軸から遠ざかるほど、それに比例して大きくなる。

【0032】

また、撮動による波面変形の視野依存性も、Zernike 多項式  $Z_r$  によって同様に記述することができる。そのため、波面変形は、視野座標の中で展開した波面変形として参照されることもある。

【0033】

図 2 ~ 4 は、

【0034】

【数 1】

10

$$Z_5(r, \theta) = \sqrt{6} r^2 \cdot \cos(2\theta),$$

$$Z_9(r, \theta) = \sqrt{5} (6r^4 - 6r^2 + 1) \text{ および}$$

$$Z_8(r, \theta) = \sqrt{8} \cdot (3r^2 - 2) \cdot r \cdot \sin(\theta),$$

20

で与えられる Zernike 多項式  $Z_5$ 、 $Z_9$  および  $Z_8$  をそれぞれ三次元描写で示したものである。

【0035】

この場合の半径座標  $r$  は、半径座標、つまり光軸からの距離を表し、 $\theta$  は方位角を表している。

【0036】

図 2 に示す Zernike 多項式  $Z_5(r, \theta)$  は、光軸上の点反射に対して偶関数である。座標変換

$$+ 180^\circ \text{ および}$$

$$r \rightarrow r$$

30

によって記述されるこのような点反射の場合、次の式が適用される。

$$Z_r(r, \theta) = Z_r(r, \theta + 180^\circ)$$

【0037】

方位角  $\theta$  には無関係であるため、図 3 に示す Zernike 多項式  $Z_9(r, \theta)$  も同様に点反射に対して偶関数である。

【0038】

しかしながら、図 4 に示す Zernike 多項式  $Z_8(r, \theta)$  は、

$$Z_8(r, \theta) = -Z_8(r, \theta + 180^\circ)$$

であるため、このような点反射に対して奇関数である。

【0039】

40

ここで、分かり易くするために、点反射に対して偶関数である Zernike 多項式  $Z_5$  のみを使用して波面変形の視野依存性を記述することができると仮定すると、このような視野依存性は、ひとみ平面 E1、E3 または中間像平面 E2 を通過することによる画像反転によっては変化しないことが分かる。同じく偶関数である Zernike 多項式  $Z_9$  によって記述されるため、図 3 に示す回転対称波面変形についても同様の考察が適用される。

【0040】

しかしながら、奇 Zernike 多項式、たとえば図 4 に示す Zernike 多項式  $Z_8$  のみを使用して波面変形の視野依存性を記述することができる場合は状況が異なる。このような場合、ひとみ平面 E1、E3 または中間像平面 E2 における画像反転の視野依存

50

性に対する影響は、このような平面の前後でもはや同じではない。

【0041】

レンズL2上の摂動22を複数の他の光エレメントのうちの1つの光活性表面を再処理することによって補償しなければならない場合、ひとみ平面E1、E3または中間像平面E2を光波が通過する際の視野依存性の上記異なる対称特性によって、広範囲にわたる様々な結果がもたらされる。これは、波面変形の視野依存性を記述することができるのには、通常、偶Zernike多項式と奇Zernike多項式の組合せによってのみであるため、これらの多項式に割り当たられる視野依存性の成分が、ひとみ平面E1、E3または中間像平面E2を通過する際に異なる方法で変換されることによるものである。

【0042】

10

これは、摂動22が存在しているセクションA1に隣接するセクションA2には、通常、適切な再処理によって視野依存性の奇数成分を除去することができる光活性表面を備えた光エレメントが存在していないことを意味している。このセクションA2内の单一の光活性表面による摂動補償が首尾良く成功するのは、視野依存性の偶数成分に対してのみである。

【0043】

しかしながら、その隣のセクションA3では、ひとみ平面E1と中間像平面E2によって生じる画像反転が互いにバランスしていないため、单一の光活性表面を再処理することによってセクションA1の摂動22を再び実質的に補償することができる。

【0044】

20

シミュレーションを使用して、対応する表面がセクションA1～A4のうちのどのセクションに存在するかによって異なる光活性表面の修正能力が立証された。表1は、残留している残留誤差をRMS(実効値)で示し、また、異なるセクションA1～A4における、適切に再処理された表面F<sub>i</sub>の修正能力を百分率で示したものである。この事例では、シミュレーションは、Zernike多項式Z<sub>13</sub>によってレンズL2上の摂動22を記述することができる、という仮定に基づいている。

【0045】

この表から、明らかに、摂動22による結像誤差を適切な再処理によって実質的に小さくすることができるのは、同じセクションA1と直ぐ隣のセクションを除く隣のセクションA3にそれぞれ存在している表面F6、F24のみであり、したがってこれらの表面が大きな修正能力を有していることが分かる。これらの修正能力と比較すると、それぞれセクションA2、A4に存在している、同じく従来の修正表面構成と見なすことができる表面F16、F46の修正能力は極めて低い。

30

【0046】

【表1】

再処理表面	セクション	誤差 (RMS)	修正能力
未再処理	-	1.6	0%
F6	A1	0.1	95.7%
F16	A2	1.3	15.8%
F24	A3	0.2	86.1%
F46	A4	1.3	21.7%

40

表1：異なる修正表面の修正能力

【0047】

以上の説明では、位置が分かっている摂動22が1つだけ存在することが仮定された。しかしながら、通常、波面変形は、複数の、その上、位置を突きとめることができないか

50

、あるいは位置を突きとめるには少なくとも相当の経費がかかる摂動によってもたらされる。これは、通常、単一の再処理表面によっては波面変形を修正することができないことを意味している。セクションA 1とA 3の間に存在しているセクションA 2の摂動は、通常、この波面変形には何ら寄与しないため、たとえばセクションA 1に存在している1つの表面と、セクションA 3に存在しているもう1つの表面を再処理することによって波面変形を補償することができる。

#### 【0048】

以上の考察から、未知の摂動を効果的に修正することができるのは、通常、連続する少なくとも2つのセクション、または偶数個の他のセクションが間に存在する2つのセクションの表面を再処理することによってのみである、と言える。この例示的実施形態の場合、この2つのセクションは、A 1とA 2の組合せ、A 2とA 3の組合せ、A 3とA 4の組合せ、およびA 1とA 4の組合せである。

10

#### 【0049】

上で説明した手段を使用した場合、修正することができるのは、視野ポイント毎に変化する波面変形の成分のみである。波面変形の視野非依存成分（オフセット）、つまりすべての視野ポイントに共通の成分は、セクションA 1～A 4の表面の局部的な再処理によっては修正することはできないが、ひとみ平面E 1、E 3のいずれか一方またはその近傍に存在する表面を再処理することによってのみ修正することができる。波面変形は、視野依存成分だけではなく、このようなオフセット成分を有していることがしばしばあるため、ほぼすべての一般的なタイプの波面変形を少なくとも大まかに修正することができるようになるためには、2つの表面のみではなく、3つの表面を再処理しなければならない。

20

#### 【図面の簡単な説明】

#### 【0050】

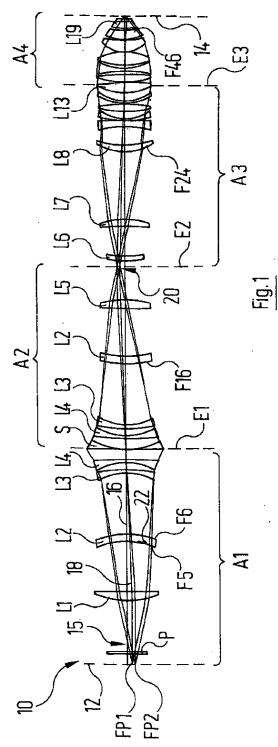
【図1】本発明による投影対物レンズを逐次描写で示す図である。

【図2】偶数波面変形を三次元描写で示す図である。

【図3】方位角に無関係の偶数波面変形を三次元描写で示す図である。

【図4】奇数波面変形を三次元描写で示す図である。

【図1】



【図2】

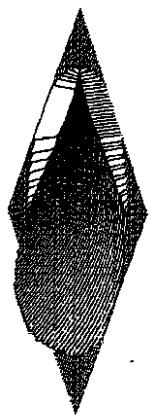


Fig.2

【図3】

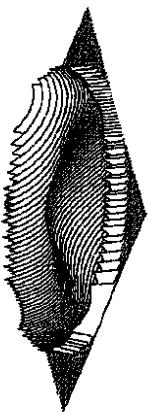


Fig.3

【図4】

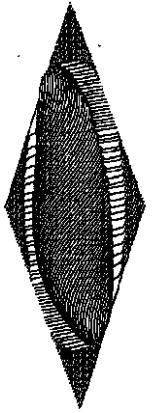


Fig.4

---

フロントページの続き

(74)代理人 100109070  
弁理士 須田 洋之

(74)代理人 100109335  
弁理士 上杉 浩

(74)代理人 100164530  
弁理士 岸 慶憲

(72)発明者 ヴァブラ, ノルベルト  
ドイツ連邦共和国・97440 ヴェルネック・アム・リンク・20

(72)発明者 エダー, ロバート  
ドイツ連邦共和国・76137 カールスルーエ・バイエルテイメール アレー 20エイ

合議体

審判長 藤原 敬士

審判官 西村 仁志

審判官 鉄 豊郎

(56)参考文献 特開2002-250865(JP, A)  
特開平10-154657(JP, A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

G02B13/24

G02B13/18

H01L21/30